03,04

Релаксация тока в монокристаллах $TIGa_{1-x}Dy_xSe_2$ (x = 0.01; 0.03)

© С.Н. Мустафаева¹, К.М. Гусейнова¹, М.М. Асадов²

¹ Институт физики НАНА, Баку, Азербайджан ² Институт катализа и неорганической химии им. М.Ф. Нагиева НАНА, Баку, Азербайджан E-mail: solmust@gmail.com

Поступила в Редакцию 23 января 2020 г. В окончательной редакции 23 января 2020 г. Принята к публикации 28 января 2020 г.

Представлены экспериментальные результаты по исследованию низкотемпературных релаксационных процессов в монокристаллах TlGa_{1-x}Dy_xSe₂ (x = 0.01; 0.03). С помощью эстафетного механизма переноса заряда, образованного на глубоких ловушках за счет инжекции носителей с контакта, определены физические параметры, характеризующие протекающие электронные процессы в образцах Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe₂-Ag: эффективная подвижность заряда, переносимого с помощью глубоких центров; контактная емкость образцов; область сосредоточения заряда в образцах; постоянная зарядки контакта; время пролета носителей заряда через образец.

Ключевые слова: релаксация тока, механизм переноса заряда, TlGa_{1-x}Dy_xSe₂, инжекция, глубокие ловушки, аккумуляция заряда.

DOI: 10.21883/FTT.2020.07.49466.010

1. Введение

Исследование релаксационных электронных процессов, связанных с эффектом накопления заряда, является одним из методов изучения физических свойств различных материалов и используется для определения важных физических характеристик [1,2]. Такие исследования имеют также прикладное значение для создания различных полупроводниковых приборов и устройств. Изучение природы и расположения локализованных состояний в полупроводниках представляет научный интерес для понимания физической основы протекающих процессов [3–5]. Эти исследования нужны также для установления природы деградации полупроводниковых материалов и приборов на их основе под действием внешнего электрического поля.

Полупроводниковые тройные халькогенидные соединения и материалы на их основе на протяжении нескольких десятилетий исследуются в качестве материалов для изготовления фоторезисторов, фотовольтаических ячеек солнечных элементов [6]. Одним из важных соединений является TlGaSe₂, которое имеет слоистую структуру и характеризуется сильной анизотропией физических свойств [7,8]. Монокристаллы TlGaSe₂ представляют интерес также в связи с высокой фоточувствительностью, эффектом памяти и тем, что в них наблюдается последовательность фазовых переходов [9,10].

Малоизученными являются монокристаллы TlGaSe₂, содержащие лантаноиды (Ln) [11]. В полупроводниковых материалах, содержащих Ln^{3+} , проявляются различные фазовые превращения. Имеют место обменные взаимодействия ионов Ln^{3+} и металлов халькогенидов,

валентные электроны которых с наивысшей энергией занимают *p*-орбиталь. Например, селениды Ln^{3+} характеризуются взаимодействием и гибридизацией между локализованными 4f- и блуждающими 5d-электронами [12]. Поэтому, частичное замещение галлия диспрозием (Dy), может заметно влиять на физические свойства TlGaSe₂. Однако, закономерности электрической релаксации в TlGaSe₂, содержащем редкоземельный элемент, не изучены. Цель работы — установление закономерностей и механизма электрической релаксации в монокристаллических образцах TlGa_{1-x}Dy_xSe₂ (x = 0.01; 0.03).

2. Методика эксперимента

В качестве исходных компонентов использовали: ТІ (Тл 00), Ga (Ga 5N), Se (ОСЧ 15-2), Dy (99.99%). Поликристаллические образцы $TlGa_{1-x}Dy_xSe_2$ (*x* = 0.01; 0.03) синтезировали из взятых в стехиометрических соотношениях элементов путем непосредственного их сплавления в вакуумированных до 10⁻² Па кварцевых ампулах при $1043 \pm 5 \,\mathrm{K}$ в течение 5–7 h. Индивидуальность синтезированных составов на основе соединения TlGaSe₂ контролировали дифференциально-термическим анализом (ДТА; NETZSCH 404 F1 Pegasus system) и рентгенофазовым анализом (РФА). РФА синтезированных образцов проведен на дифрактометре марки D8-ADVANCE в режиме $0.5^{\circ} < 2\Theta < 100^{\circ}$ (Си*К* α -излучение, $\lambda = 1.5406$ Å) при 40 kV и 40 mA. Из синтезированных образцов TlGa_{1-x}Dy_xSe₂ (x = 0.01; 0.03) методом Бриджмена выращивали монокристаллы, аналогично описанному в [11].

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) и релаксационные процессы изучали стандартной методикой [7]. Скалыванием по плоскости естественного скола от массивных монокристаллов TlGa_{1-x}Dy_xSe₂ (x = 0.01; 0.03) готовили образцы, которые имели толщину (L) порядка от 10 до 40 µm. В качестве электродов использована серебряная паста. Образцы Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe₂-Ag готовили в сэндвич-варианте так, что постоянное электрическое поле к ним прикладывали в направлении, параллельном оси "С" образца. Измеряемый образец помещался в азотный криостат. Электрические измерения образцов проведены при фиксированной температуре 85 К. Напряжение на образец подавалось от стабилизированного источника питания. Значение тока через образец Ag-TlGa1-xDyxSe2-Ag определяли электрометром по величине падения напряжения на известном нагрузочном сопротивлении. Погрешность измерения тока составляла 3-5%.

3. Результаты и их обсуждение

По данным ДТА температура плавления синтезированного TlGaSe₂ составляет 1143 ± 1 К. На дифрактограммах РФА образцов TlGa_{1-x}Dy_xSe₂ (x = 0.01; 0.03) имеющиеся рентгеновские рефлексы соответствовали фазе TlGaSe₂ и рефлексы других фаз отсутствовали. Структура синтезированных кристаллов TlGaSe₂ и TlGa_{1-x}Dy_xSe₂ соответствует моноклинной сингонии с пространственной группой C₆^{2h} (C 2/c) при 298 К. Опреденные параметры элементарной ячейки образнов TlGa_{1-x}Dy_xSe₂ (a = 15.623 (0.0002), b = 10.773 (0.0002), c = 10.744 (0.0002) Å согласуются с данными для TlGaSe₂ [11].

Релаксационные явления в образцах $TIGa_{1-x}Dy_xSe_2$ проявляются в области низких температур. Ниже приведены результаты изучения релаксационных явлений в монокристаллах $TIGa_{1-x}Dy_xSe_2$ (x = 0.01; 0.03), измеренных на постоянном токе (I) при T = 85 К. Темновое удельное омическое сопротивление (ρ) монокристаллов $TIGa_{1-x}Dy_xSe_2$ при 85 К составляло 7.5 · 10¹⁰ при x = 0.01 и 5.2 · 10¹⁰ Ω · ст при x = 0.03. Т.е. с увеличением концентрации диспрозия, введенного в матрицу $TIGaSe_2$, проводимость образцов увеличивалась.

Протекание темнового электрического тока в образцах $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$ сопровождалось релаксацией при постоянном приложенном напряжении (U). Проведены измерения временных изменений темновых токов при различных приложенных электрических полях.

На рис. 1, *a*, *b* представлены временные изменения тока в Ag–TlGa_{1-x}Dy_xSe₂–Ag (x = 0.01; 0.03) при электрических напряжениях от 100 до 250 V и T = 85 К. При этом наблюдается спад тока со временем с последующим установлением стационарного уровня тока. Вследствие изменения величины тока со временем ВАХ образцов обнаруживали гистерезис. Увеличение време-



24

Рис. 1. Релаксация темнового тока (I) в монокристаллических образцах Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag (толщина образца $L = 10 \,\mu$ m) (*a*) и Ag-TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂-Ag ($L = 40 \,\mu$ m) (*b*) при различных приложенных напряжениях *U*, V: *I* — 100; *2* — 150; *3* — 200; *4* — 250. *T* = 85 K.

ни действия напряжения приводило к смещению ВАХ в сторону меньших токов.

На рис. 2 показаны установившиеся ВАХ образцов Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag (кривая *1*) и TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂ (кривая *2*). Кривая *1* при напряженности приложенного постоянного электрического поля $F = 10^4 - 10^5$ V/cm характеризовалась линейным участком $I \sim F$, а при напряжении $U > 10^5$ V/cm после небольшого "горба" наблюдалась квадратичная область $I \sim F^2$ вплоть до $3 \cdot 10^5$ V/cm. Для Ag-TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂-Ag (кривая *2*) линейный участок был короче, а квадратичная область ВАХ наблюдалась начиная с $F = 5 \cdot 10^4$ V/cm. При этом здесь (кривая *2*) также квадратичному участку предшествовал небольшой "горб".

Спадающая релаксация тока, наблюдаемая в образцах $Ag-TIGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$, сопровождалась накоплением заряда. При отключении внешнего электрического напряжения и закорачивании контактов (электродов из Ag) в цепи протекал ток разрядки, направление которого

а



 10^{4}

Рис. 2. Стационарные ВАХ образцов Ag–TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂– Ag (толщина образца $L = 10 \,\mu$ m) (кривая l) и Ag–TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂–Ag ($L = 40 \,\mu$ m) (кривая 2) при T = 85 К.

F, V/cm

 10^{5}



Рис. 3. Зависимость величины заряда (Q), накопленного в образцах Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag ($L = 10 \mu$ m) (a) и Ag-TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂-Ag ($L = 40 \mu$ m) (b), от времени выдержки (t) приложенных электрических напряжений U, V: I - 100; 2 - 150; 3 - 200; 4 - 250. T = 85 К.

было противоположно направлению тока при внешнем напряжении. Чтобы полностью разрядить образец $Ag-TIGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$, последний либо прогревали до высокой температуры, либо освещали светом. Заряд, накапливаемый в изученных образцах, вычисляли по площади, лежащей под кривой зависимости тока от

времени:
$$Q = \int_{0} I dt$$

На рис. 3 приведены зависимости величины заряда, накопленного в образцах $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag(x = 0.01 и 0.03)$, от времени выдержки различных приложенных напряжений. Величины напряжений от 100 до 250 V соответствовали неомическим участкам BAX образцов $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$, т.е. это те приложенные напряжения, когда в $TlGa_{1-x}Dy_xSe_2$ имела место спадающая релаксация тока. При увеличении времени действия напряжения на образцах $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$ заряд накапливался медленнее и постепенно достигал насыщения.

Изменение приложенного электрического напряжения при фиксированном времени его действия влияло на величину накапливаемого заряда в Ag–TlGa_{1-x}Dy_xSe₂–Ag. На рис. 4 для Ag–TlGa_{1-x}Dy_xSe₂–Ag представлены зависимости накопленного заряда (Q) от напряжения (U) при фиксированных временах его приложения t = 3 и 10 s. Из рис. 4 видно, что для Ag–TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂–Ag зависимость Q(U) носит линейный характер: $Q \sim U$, а для образца состава TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂ наблюдается квадратичная зависимость $Q \sim U^2$.

Для интерпретации полученных результатов нами привлечена модель эстафетного механизма переноса инжектированного в кристалл заряда [13], учитывающая указанные выше особенности протекания тока в систе-



Рис. 4. Зависимости величины накопленного заряда (*Q*) от напряжения, приложенного к образцам Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag ($L = 10 \,\mu$ m) и Ag-TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂-Ag ($L = 40 \,\mu$ m) в течение времени *t*, s: *I* — 10 и *2* — 3. *T* = 85 K.

ме металл-полупроводник-металл (М-П-М). Модель предполагает наличие в полупроводниковом кристалле центров с глубокими уровнями захвата, по которым возможна прыжковая проводимость. При высокой концентрации таких центров перенос с их помощью инжектированного в кристалл заряда вносит преобладающий вклад в электрическую проводимость кристалла. Используемые образцы $TlGa_{1-x}Dy_xSe_2$ характеризуются высокой плотностью локализованных вблизи уровня Ферми состояний $(2.97-7.14) \cdot 10^{18} \, \text{eV}^{-1} \text{cm}^{-3}$, по которым осуществляется прыжковая проводимость. При переносе заряда такими локальными центрами в образце $Ag-TIGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$ на аноде, согласно модели [13], имеется барьер, затрудняющий перетекание на него инжектированных с катода электронов. Энергетический барьер на границе с анодом возникает вследствие разности энергии сродства электрона к локальному центру и работы выхода металла анода. Вследствие этого ток ограничивается как пространственным зарядом в объеме $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$, так и барьером на аноде. В результате этого вблизи анода скапливается заряд, что приводит к перераспределению приложенного к монокристаллу $TlGa_{1-x}Dy_xSe_2$ электрического напряжения. А это, в свою очередь, приводит к тому, что падение напряжения на контакте возрастает со временем, а сила тока через $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$ спадает.

Теория нестационарного инжекционного тока с учетом уровней захвата в запрещенной зоне кристаллов известна [14]. Но в этой теории инжекционный ток, как и в [15], обусловлен переносом заряда через зону проводимости кристалла. Особенностью тока, ограниченного пространственным зарядом [14,15], является то, что заряд, переносимый током, не превышает значение $C_g U$, где C_g — геометрическая емкость образца, U — приложенное к нему напряжение. Геометрическая емкость изученных образцов Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe₂-Ag составляла $(40-45) \cdot 10^{-12}$ F. Максимальное напряжение, при котором наблюдалась спадающая релаксация тока в $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$, составляло 250 V, а это значит, что оцененный максимальный заряд, который может быть накоплен в системе $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$, составляет 1.1 · 10⁻⁸C. Однако, из экспериментов получены значительно большие значения $Q = (4-6) \cdot 10^{-7} \,\mathrm{C}$ при 250 V (рис. 3 и 4). При напряжении, соответствующием квадратичному участку ВАХ образца TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂ заряд, накопленный в нем, изменялся по закону: $Q \sim U$ (рис. 4), что соответствует модели [13]:

$$Q = C_c \cdot U. \tag{1}$$

По формуле (1) оценена контактная емкость образца Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag: $C_c = 2.4 \cdot 10^{-9}$ F. Знание емкости C_c позволило по формуле $C_c = \varepsilon \varepsilon_0 S/d_c$ определить толщину области сосредоточения заряда в образце TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂: $d_c = 6.7 \cdot 10^{-5}$ cm.



Рис. 5. Зависимости заряда Q от тока \sqrt{I} в образцах Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag $(L = 10 \,\mu\text{m})$ (кривая I) и Ag-TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂-Ag $(L = 40 \,\mu\text{m})$ (кривая 2) при напряжении U = 100 V.

В [13] для величины накопленного заряда в системе М-П-М при малых временах поляризации получена формула

$$Q = \mu_j \varepsilon \varepsilon_0 S \frac{U^2}{L^3} \cdot t, \qquad (2)$$

где μ_f — подвижность заряда, переносимого через запрещенную зону полупроводника; ε_0 — диэлектрическая постоянная; ε — диэлектрическая проницаемость полупроводника; *S* — площадь контакта; *L* — толщина полупроводника; *U* — поляризующее напряжение; *t* — время поляризации.

Квадратичная зависимость Q(U) экспериментально получена для образца состава $TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se_2$ (рис. 4). По наклону графика зависимости $Q \sim U^2$ оценена величина подвижности заряда, переносимого при помощи локальных центров в запрещенной зоне монокристалла $TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se_2$ при T = 85 K: $\mu_f = 8.8 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}.$

Величина тока, протекающего через систему М–П–М, и величина накопленного заряда связаны следующим уравнением [13]:

$$Q = UC_c - \sqrt{\frac{C_c L^3 I}{\mu_f \cdot d}}.$$
(3)

Из уравнения (3) видно, что в каждый момент времени заряд пропорционален корню квадратному из величины тока, протекающего через систему $M-\Pi-M$. Такая зависимость (3) соблюдается для времен и напряжений, соответствующих спадающим ветвям инерционных характеристик. Причем, чем меньше напряжения и соответствующие времена, тем точнее выполняется указанная зависимость.

На рис. 5 представлены зависимости величины заряда, аккумулированного в Ag–TlGa_{1-x}Dy_xSe₂–Ag (x = 0.01 и 0.03) за различные промежутки времени, от величины тока, измеренного при тех же временах. Полученные зависимости относятся к фиксированному напряжению в области спадающих инерционных характеристик

(U = 100 V). Здесь значения тока *I* соответствуют экспериментальным значениям тока за вычетом величины фонового тока I_{ph} , которая соответствует току утечки. В опытах величину I_{ph} выбирали равной минимальному значению тока на долговременной спадающей инерционной характеристике при указанном напряжении. Линейность построенных графиков на рис. 5 в координатах Q от \sqrt{I} находится в согласии с формулой (3). Экстраполяцией прямых *I* и *2* на рис. 5 получены значения токов отсечки (I_c) при Q = 0: $4.4 \cdot 10^{-8}$ А для образца $TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se_2$ и $6.8 \cdot 10^{-8}$ А для $TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se_2$. Тогда из формулы (3) получим

$$\mu_f = \frac{L^3 I_c}{U^2 C_c d_c},\tag{4}$$

Вычисленное по формуле (4) значение μ_f для TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂ составило 2.7 · 10⁻⁸ cm²/V · s. Как показано выше, для TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂ получено значение $\mu_f = 8.8 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s.}$ По формуле [13]:

$$\tau = \frac{L^3}{\mu_f d_c \cdot U},\tag{5}$$

для Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag вычислена постоянная зарядки контакта: $\tau = 5.5$ s. Время пролета носителей заряда (t_t) через Ag-TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂-Ag определили по формуле:

$$t_t = \frac{\tau \cdot d_c}{L}.\tag{6}$$

Вычисленное значение t_t составило 0.37 s.

Наличие на ВАХ образцов ТІGа_{1-x}Dy_xSe₂ (рис. 2) участков $I \sim U^2$ соответствует формуле [13]:

$$I = \mu_f \varepsilon \varepsilon_0 S \cdot \frac{U^2}{L^3}.$$
 (7)

Формула (7) напоминает формулу для тока, ограниченного пространственным зарядом, когда инжекционный ток обусловлен переносом заряда по разрешенной зоне [15]. Отличие в том, что в теории эстафетной проводимости [13] инжекционный ток обусловлен переносом носителей заряда через запрещенную зону кристалла. Если электропроводность полупроводника осуществляется по состояниям в разрешенных зонах, то ее экспоненциальную зависимость от температуры определяет, в основном, температурная зависимость концентрации носителей заряда, а температурной зависимостью подвижности можно пренебречь ($\sigma = ne\mu$). В случае прыжкового (или эстафетного) механизма переноса заряда по локализованным состояниям основной вклад в проводимость дает термическая активация подвижности [16]:

$$\mu_f \sim \exp(-\Delta E/kT),$$
 (8)

где ΔE — энергия активации процесса переноса.

4. Заключение

Таким образом, обнаружено, что в выращенных монокристаллических образцах $TlGa_{1-x}Dy_xSe_2$ (x = 0.01; 0.03) при $T = 85 \,\mathrm{K}$ в постоянном электрическом поле протекают релаксационные электронные процессы, обусловленные аккумулированием в них зарядов. Установлено, что спадающая релаксация тока при различных электрических полях, гистерезис ВАХ и накопление заряда в образцах $Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe_2-Ag$, изготовленных в сэндвич-варианте, согласуются с эстафетным механизмом переноса заряда, образованного на глубоких энергетических уровнях в запрещенной зоне за счет инжекции носителей с контакта. Определены физические параметры, характеризующие электронные релаксационные процессы в образцах Ag-TlGa_{1-x}Dy_xSe₂-Ag (x = 0.01; 0.03): эффективная подвижность заряда, переносимого с помощью глубоких центров $\mu_f = 2.7 \cdot 10^{-8}$ для TlGa_{0.99}Dy_{0.01}Se₂ и 8.8 · 10⁻⁸ cm²/V · s для TlGa_{0.97}Dy_{0.03}Se₂ при 85 K; контактная емкость образцов $C_c = 2.4 \cdot 10^{-9}$ F; область сосредоточения заряда в кристаллах $d_c = 6.7 \cdot 10^{-5}$ cm; постоянная зарядки контакта $\tau = 5.5$ s; время пролета носителей заряда через образец $t_t = 0.37$ s.

Финансирование работы

Авторы работы выражают благодарность Фонду развития науки при Президенте Азербайджанской Республики (гранты № E-F-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/05/ 1-М-13 и № E-F-BGM-4-RFTF-1/2017-21/05/1-М-07) и научному фонду государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR проект № 12LR — АМЕА. 2018).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- I.M. Hodge. Classical Relaxation Phenomenology. Springer Nature Switzerland AG (2019). DOI: org/10.1007/978-3-030-02459-8
- [2] *Relaxation Phenomena*/ Eds W. Haase., S. Wróbel. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg GmbH (2003).
 DOI: org/10.1007/978-3-662-09747-2
- [3] X. Wang, Q. Zhou, H. Li, C. Hu, L. Zhang, Yu Zhang, Y. Zhang, Yu Sui, Bo Song. Citation: Appl. Phys. Lett. 112, 122103 (2018). DOI: org/10.1063/1.5019759
- [4] X. Jiang, P. Sun, Q. Peng, W. Sima. J. Phys. D 51, 015306 (2018). DOI: org/10.1088/1361-6463/aa9a6e
- [5] A. Zhao, L. Xu, X. Zhang, J. Deng, G. Zhang, X. Zhao. AIP Adv. 8, 075323 (2018). DOI: org/10.1063/1.5027686
- [6] O. Madelung. Semiconductors: Data Handbook. 3rd ed. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg (2004). 705 p. DOI: org/10.1007/978-3-642-18865-7

- [7] С.Н. Мустафаева, А.И. Гасанов. ФТТ 46, 11, 1937 (2004).
- [8] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов. ФТТ 55, 12, 2346 (2013).
- [9] О.Б. Плющ, А.У. Шелег. Кристаллография **44**, *6*, 873 (1999).
- [10] А.У. Шелег, К.В. Иодковская, Н.Ф. Курилович. ФТТ **40**, *7*, 1328 (1998).
- [11] С.Н. Мустафаева, С.М. Асадов. Неорган. материалы 54, 7, 662 (2018).
- [12] Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry. Sc, Y, La-Lu Rare Earth Elements. Compounds with Se./ Ed. H. Bergmann, Ed., (Springer, Berlin (1986), 8th ed. System N 39. 555 p.
- [13] Б.Л. Тиман. ФТП 7, 2, 225 (1973).
- [14] A. Many, G. Rakavy. Phys. Rev. 126, 1980 (1962).
- [15] М. Ламперт, П. Марк. Инжекционные токи в твердых телах. Мир, М. (1973). 416 с.
- [16] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1974). 472 с.

Редактор Т.Н. Василевская